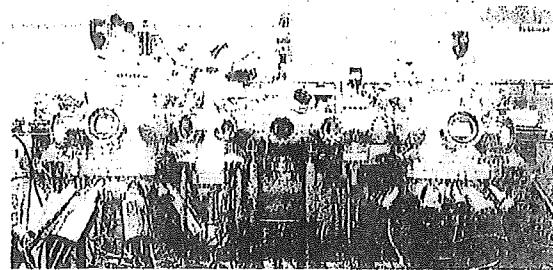


エピクエスト

会員の
M
B
E
装
置
を
受
注

株式会社エピクエスト(京都府
亀岡市篠町王子下上牧三
一六、二〇七七一、二九一
四六六六、前野弘志社長)
は、このほど累計出荷台数
一〇〇台目となる大型MB
E装置を受注した。さらに
新製品であるVCSEL装置
造用酸化炉を発売したほか、
新型Kセルなど研究開
発にも注力。エピ事業への
進出を検討するなど、積極
的な事業展開を図っている。

同社は、八四年に発足し
た日新電機の事業部を前身として、二〇〇〇年六月に
設立された。世界的にも珍
しいMOCVDとMBE両
方を手がける装置メーカー
で、装置によってまらずKセ
ルや制御電源などの部材、
メンテナンスや改造・移設
などのサービスも提供。研
究開発や小規模量産向けを
ターゲットとして、ユーザ
ーの要望に応じた特殊分野
で強みを發揮している。
一〇〇台目となるMBE
装置は、OELICを研究開
発している豊橋技術科学大
学から受注した。同社のM
BE装置は、真空搬送室を
中心としたマルチチャンバ
ーが特徴。超高真空中で三
六〇度搬送できる三段ア
ームロボットを自社開発して
いる。主なMBE装置の
ラインアップとして、研
究用に「RC1100」「R



豊橋技術科学大学に納めたMBE装置

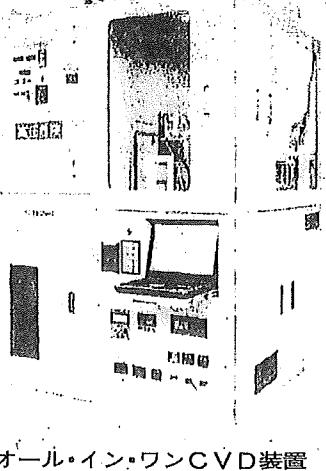
窒化物系アルミセル
を開発中で、うちデ
ュアルセルは年内納
入が決定。光セルの
開発は、中小企業
ベンチャーフィンанс
から認定を受け、研
究開発助成金を交付
された。同社は、世
界で初めてSi用高
温Kセルを開発・商
品化した実績があり、
多彩なセルを商
品化することでユ
ーザーの研究開発の自
由度を高めることに
貢献していく考え。

今期は、窒化物系短波長
デバイス用や国際プロジェクト
関連、動きの出始めた
光通信分野向けの受注が伸
び、五台の受注、売上高五
億円を見込んでいます。来期
はSiC用CVDや窒化物
用MOCVD、新商品であ
る酸化炉などが売上に貢献
していくことで、增收を見
込んでいる。また、エピク
エラー作成の事業化を検討
しており、装置ユーザーで
あるデバイスマーケターとの
協力を仰いでいくことも視
野に入れている。

エピクエスト

C
O
R
E
L
·
I
N
·
W
O
N
C
V
D
装
置
を
發
売

1.3 m 角の低フットプリント・低価格を実現



オール・イン・ワンCVD装置

株式会社エピクエストは、一
次元ですべての機能を収
めたコンパクトな「オール
イン・ワンCVD装置」
を開発することで、プロセスユ
ニット部、ガス制御部、シ
リンダーキャビネット部、
電機制御部を一・三m角の
低フットプリントに設置し
た研究開発用装置。横型円
筒石英リアクターを搭載
し、「インチウエハー」の枚
葉処理ができる。高周波誘
導加熱方式で、一五〇〇°Cま
で加熱可能。

ガス制御部は、MFCに
よる流量制御でラン/ベン
トルシリンダー三本を搭載
できる。プロセス排気はメ
カニカルブースターポンプ
とロータリーポンプを搭
載。シーケンサーによるイ
ンターロック機能、異常時
処理機能、PCを用いた自
動成長プロクラミング機能
も搭載した。

主な仕様は、外形寸法一
三〇〇X一三〇〇X二一〇
〇mm、重量七五〇kg、必要
電力三相・二〇〇V・一五
〇A、冷却水四〇リットル
/分MAX、圧縮空気圧力
約五kg/cm²。

商品化した。
一方、研究面では、蒸発
源である新型Kセルの開発
を進めている。ヒーターに
代えて光で試料を加熱する
装置を発売した。価格は五〇〇
〇万円。
新製品は二階建て構造を

C
3
4
0
0
」がある。
開発した量産用酸化炉
「VOX-3001」は、光
通信用に開発が進むGaAs
系VCSELの量産に最
適。三インチ枚葉処理(二
インチ複数枚も可)に対応
し、マスクフロー・コントロ
ーラーで純水の供給量を精密
に制御することで、高精度
な酸化狭窄プロセスを実現
する。すでに受注を得てお
り、一月末のデモ機完成に
向けて作業を急いでいる。そ
の他、一・三m角にすべて
の機能を収めた「オール・
イン・ワンCVD装置」も

C
2
1
0
0
」、量産用「P
C
3
4
0
0
」がある。

開発した量産用酸化炉
「VOX-3001」は、光
通信用に開発が進むGaAs
系VCSELの量産に最
適。三インチ枚葉処理(二
インチ複数枚も可)に対応
し、マスクフロー・コントロ
ーラーで純水の供給量を精密
に制御することで、高精度
な酸化狭窄プロセスを実現
する。すでに受注を得てお
り、一月末のデモ機完成に
向けて作業を急いでいる。そ
の他、一・三m角にすべて
の機能を収めた「オール・
イン・ワンCVD装置」も

開発した量産用酸化炉
「VOX-3001」は、光
通信用に開発が進むGaAs
系VCSELの量産に最
適。三インチ枚葉処理(二
インチ複数枚も可)に対応
し、マスクフロー・コントロ
ーラーで純水の供給量を精密
に制御することで、高精度
な酸化狭窄プロセスを実現
する。すでに受注を得てお
り、一月末のデモ機完成に
向けて作業を急いでいる。そ
の他、一・三m角にすべて
の機能を収めた「オール・
イン・ワンCVD装置」も